

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 17 年 6 月 30 日 (2005.6.30)

【公開番号】特開 2002-226573 (P2002-226573A)

【公開日】平成 14 年 8 月 14 日 (2002.8.14)

【出願番号】特願 2002-505 (P2002-505)

【国際特許分類第 7 版】

C 08 G 64/30

【F I】

C 08 G 64/30

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 10 月 14 日 (2004.10.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の一連の工程を改良点として有するジアリールカーボネートとジヒドロキシアリール化合物との溶融下エステル交換反応：

(i) 生成する蒸気流を第 1 蒸留塔の中央高さに導入する工程、

(ii) この蒸気流を高純度モノヒドロキシアリール化合物を含有する頂部生成物と第 1 底部生成物とに分離する工程、

(iii) (ii) の高純度モノヒドロキシアリール化合物を該反応にリサイクルする工程

、

(iv) 第 1 底部生成物を第 2 蒸留塔の中央高さに導入する工程、

(v) 第 1 底部生成物を高沸点底部副生成物と塔頂残留構成物とに分離する工程、

(vi) 塔頂残留構成物を第 3 蒸留塔の中央高さに導入する工程、

(vii) 該塔頂残留構成物を塔頂低沸点画分とジアリールカーボネート生成物を含有する底部生成物または側流生成物とに分離する工程、及び

(viii) ジアリールカーボネート生成物を直接エステル交換反応にリサイクルする工程

。